

内 海 陸 上 航 空

鈴 木 祐 一  
近 藤 昭 夫

High Performance INVT

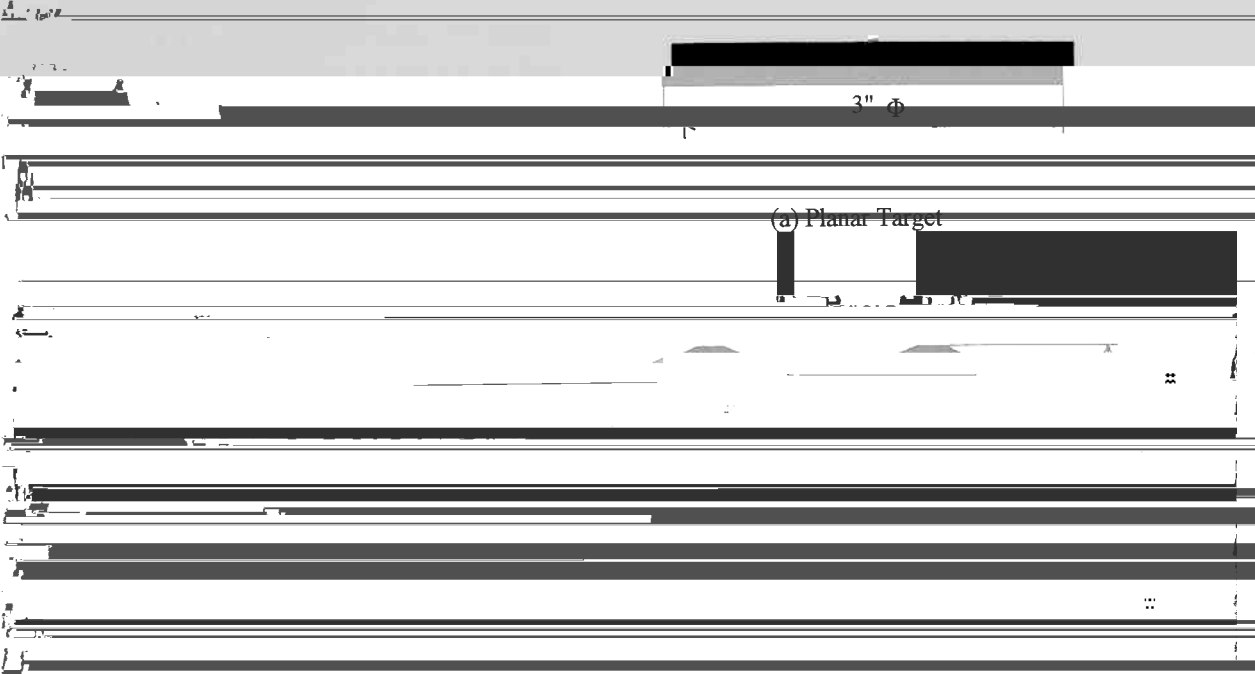


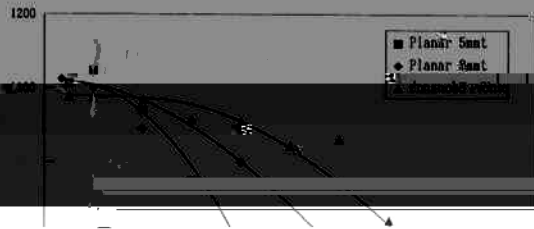
Fig. 1 Schematic illustration of the target (a)

Table 2. Scattering Conditions

Scattering Angle	Scattering Ratio	Scattering Ratio	Scattering Ratio
0°	0.00	0.00	0.00
15°	0.00	0.00	0.00
30°	0.00	0.00	0.00
45°	0.00	0.00	0.00
60°	0.00	0.00	0.00
75°	0.00	0.00	0.00
90°	0.00	0.00	0.00
105°	0.00	0.00	0.00
120°	0.00	0.00	0.00
135°	0.00	0.00	0.00
150°	0.00	0.00	0.00
165°	0.00	0.00	0.00
180°	0.00	0.00	0.00

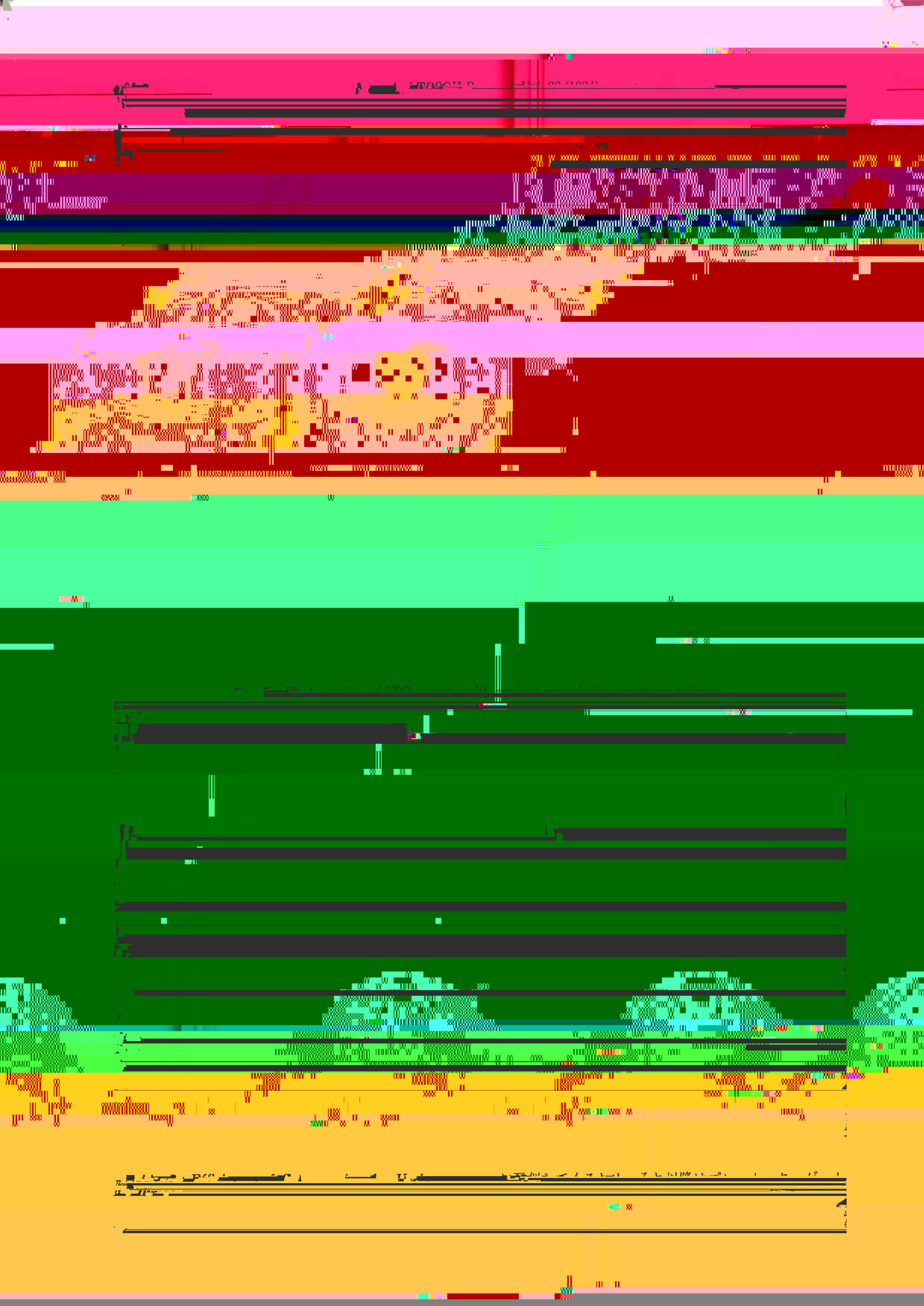


Fig. 4 Changes of DC current and voltage constant



cumulative sputtering time

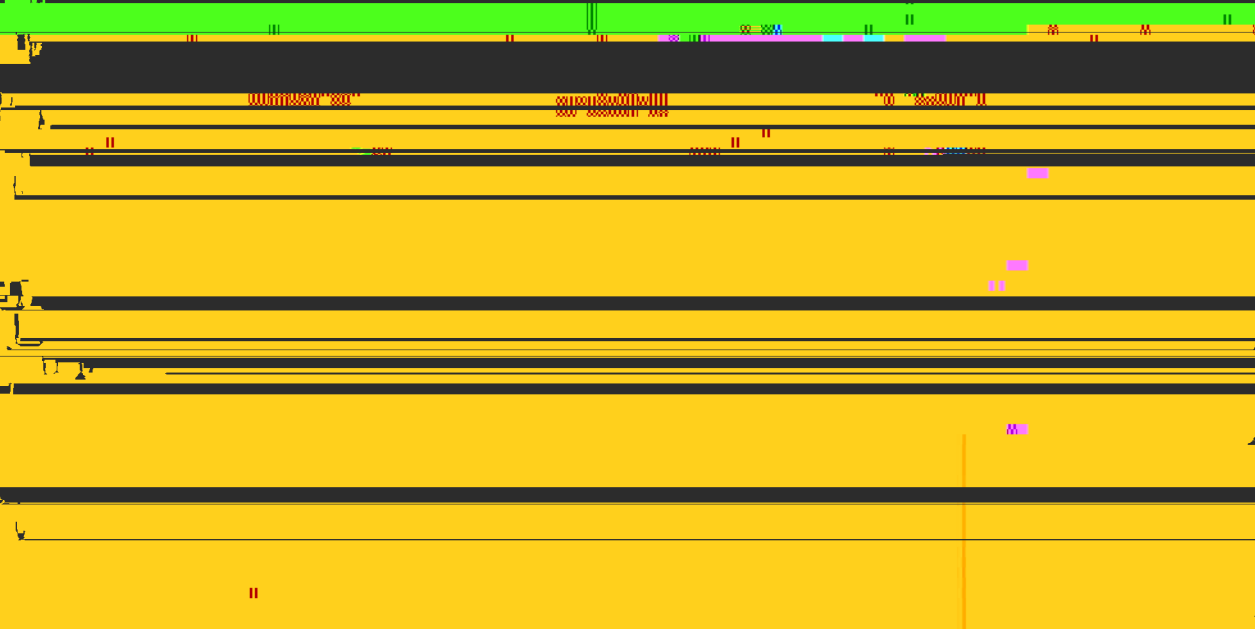
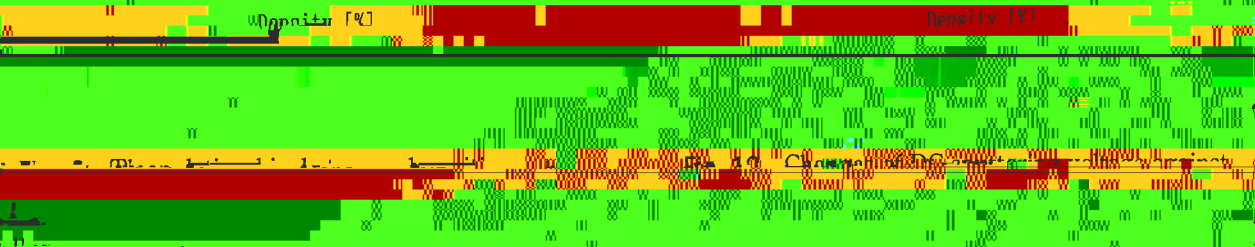
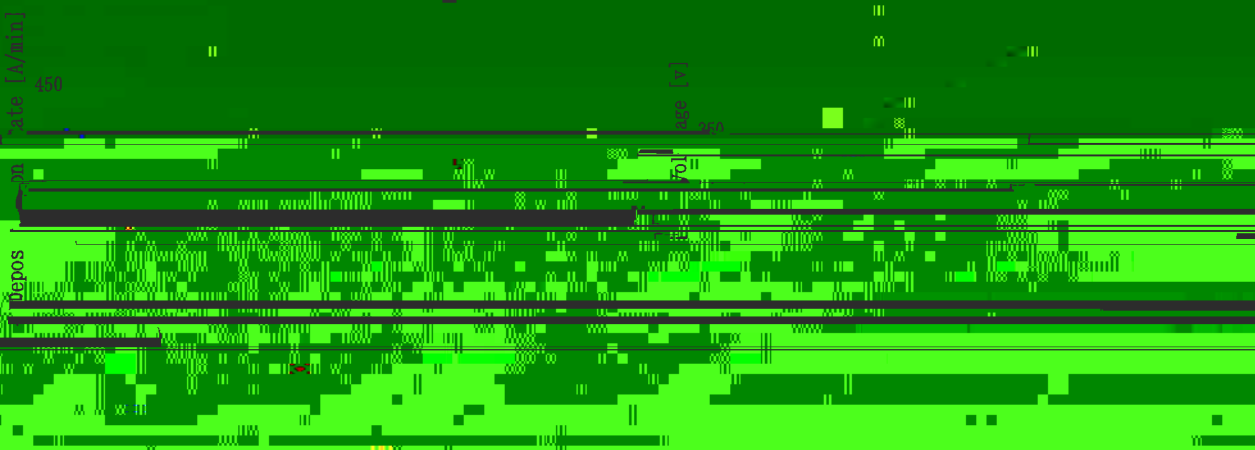
0







0000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000



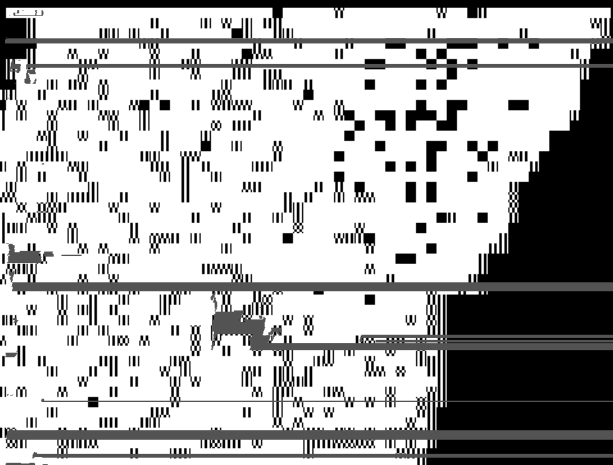
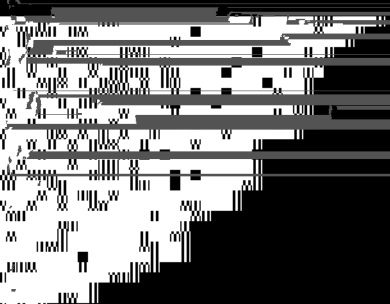


図1-10 図1-9のターゲットの中心部を拡大した様子

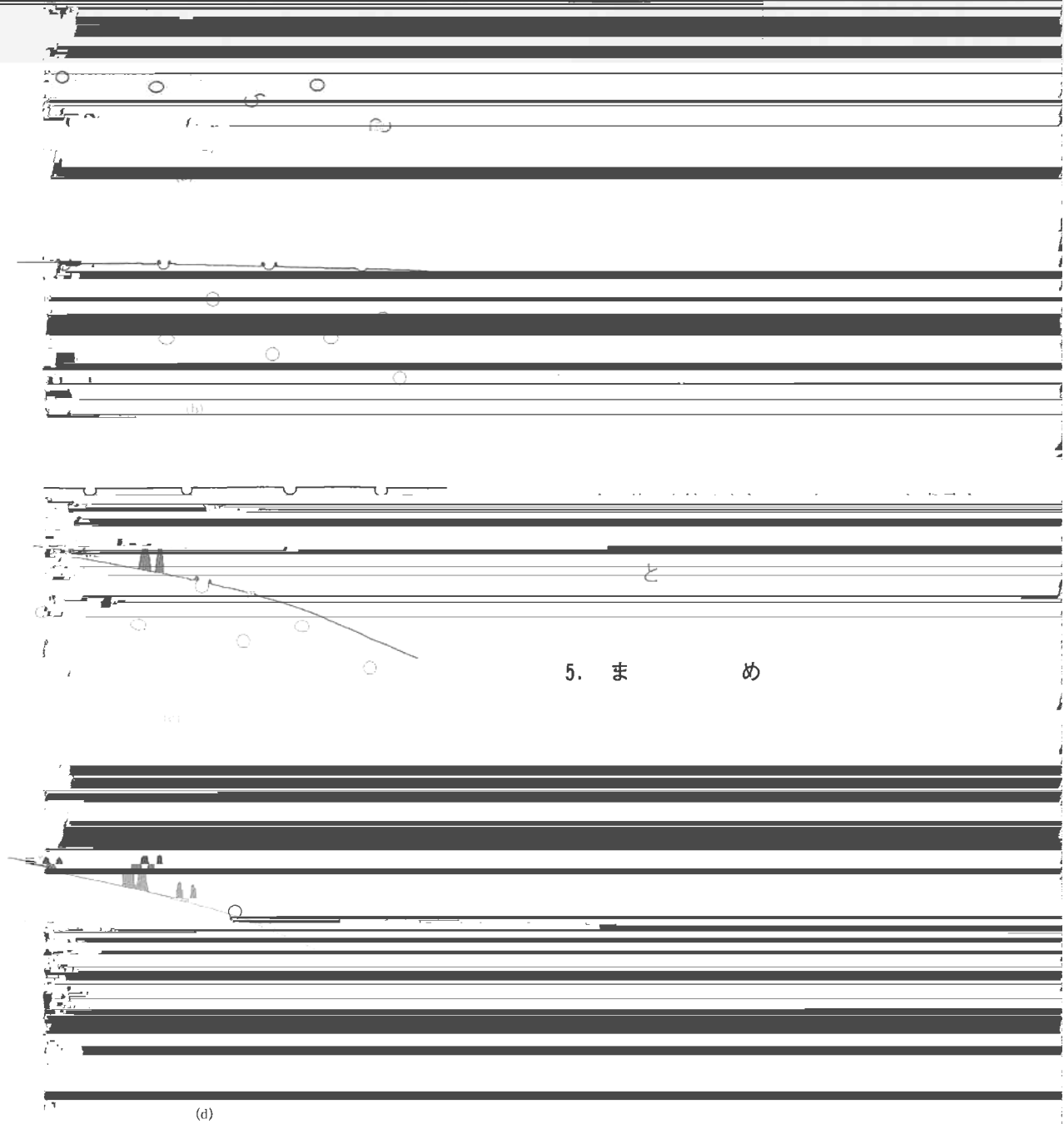


(d) スパッタリング層

ここで、今回の実験により明らかになった現象をまと

めると図1-11のようになる。

① ノジュールは、ターゲットの中心部、外周部および



5. ま め

Fig. 13. Schematic illustration of mechanism of

nodular growth: (a) non-spattered target



- 6) T. Yokoyama, S. Tanaka, K. Echima, D. Amaki, 7) 岩元・他 日本国特許 特開平1-200550

